

СОДЕРЖАНИЕ

Том 52, номер 2, 2023

ДИАГНОСТИКА

Измерения на РЭМ размеров рельефных структур в технологическом процессе производства микросхем

Ю. А. Новиков, М. Н. Филиппов

87

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Исследование возможности оптимизации взаимодействия NV-центров и фотонов путем изменения формы микрорезонаторов

А. В. Цуканов, И. Ю. Катеев

96

ЛИТОГРАФИЯ

Сечения процессов рассеяния при электронно-лучевой литографии

А. Е. Рогожин, Ф. А. Сидоров

110

ПРИБОРЫ

Оксидные мемристоры для ReRAM: подходы, характеристики, структуры

А. Г. Исаев, О. О. Пермякова, А. Е. Рогожин

127

ТЕХНОЛОГИЯ

Параметры плазмы и кинетика реактивно-ионного травления SiO_2 и Si_3N_4 в смеси $\text{HBr}/\text{Cl}_2/\text{Ar}$

А. М. Ефремов, В. Б. Бетелин, К.-Н. Кwon

152

Исследование оптических свойств сверхтонких пленок на основе силицида металлов

Э. А. Керимов

160
